

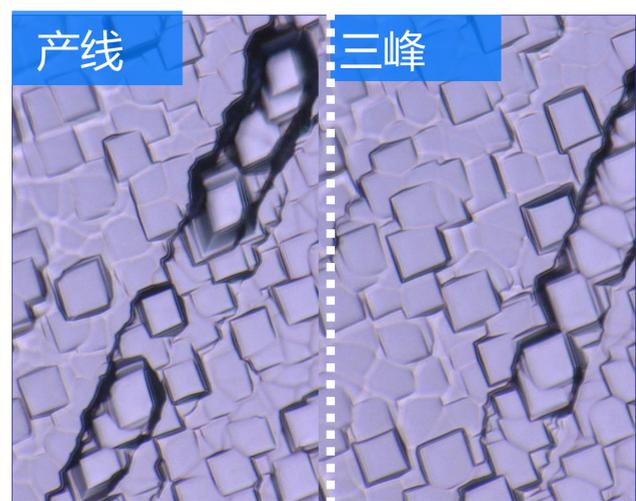
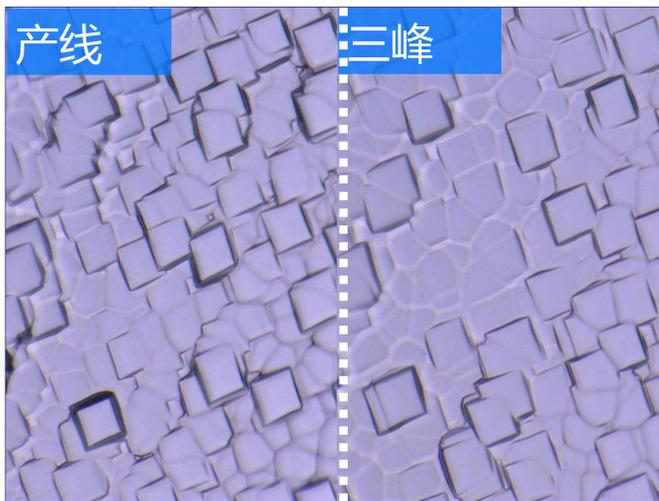


碱抛光优化剂  
BPL系列

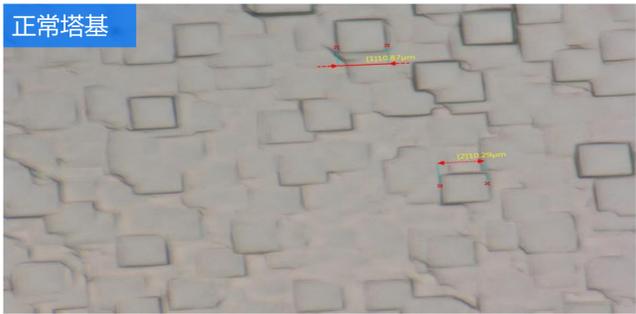
**适用性强，效率高**  
适用TOPCon和PERC不同工艺，具有更好的保护性及更优的效率

Item	Eta	Uoc	Isc	FF	IRev2	Rs	Rsh
BL对照组	24.910	0.7172	13.6464	84.014	0.0254	0.000269	4792
SF实验组	24.941	0.7168	13.6264	84.299	0.0298	0.000162	4414
BL对照组	23.405	0.6916	13.587	82.224	0.112	0.0012	443
SF实验组	23.433	0.6919	13.598	82.218	0.104	0.0012	462

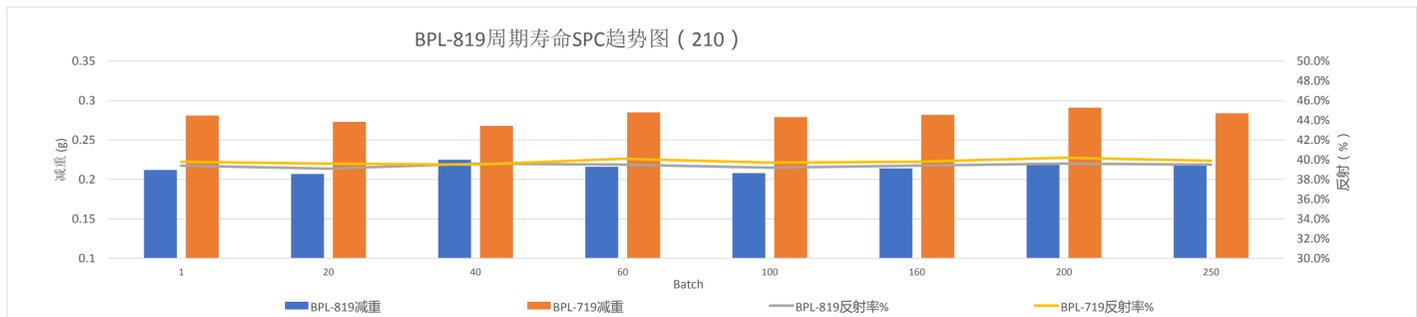
**塔基平整均匀**  
叁峰碱抛添加剂可使塔基更平整均匀，沟壑深度更浅，缝隙间距衔接更紧密



**良好的稳定性**  
周期内工艺稳定，波动较小



**工艺窗口大**  
塔基可调范围广，适用不同减重



**适用性强，效率高：**  
适用不同工艺，工艺窗口大，效率更优。

**塔基平整均匀：**  
碱抛光之后绒面平整，塔基衔接良好，沟壑深度更浅。

**良好的稳定性：**  
周期内工艺稳定，整体波动小。